

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7645953号
(P7645953)

(45)発行日 令和7年3月14日(2025.3.14)

(24)登録日 令和7年3月6日(2025.3.6)

(51)国際特許分類

F I

A 4 5 D 29/18 (2006.01)

A 4 5 D 29/18

A 4 5 D 29/11 (2006.01)

A 4 5 D 29/11

請求項の数 5 (全12頁)

(21)出願番号	特願2023-151498(P2023-151498)	(73)特許権者	516013310
(22)出願日	令和5年9月19日(2023.9.19)		田邊 みほ
(62)分割の表示	特願2022-87995(P2022-87995)の分割		大阪府大阪市中央区南本町3-3-22 本町エイトビル9階 株式会社D i v a内
原出願日	令和4年5月30日(2022.5.30)	(74)代理人	110000947
(65)公開番号	特開2023-175838(P2023-175838 A)		弁理士法人あーく事務所
(43)公開日	令和5年12月12日(2023.12.12)	(72)発明者	田邊 みほ
審査請求日	令和5年9月19日(2023.9.19)		大阪府大阪市中央区南本町3-3-22 本町エイトビル9階 株式会社D i v a内
		審査官	大内 康裕
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 ネイル施術方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤を用いるネイル施術方法であって、
指の先端部よりも長く伸びた爪の表面にネイル施術されたネイル装飾部が設けられ、前記爪の裏面側は、前記指の先端部よりも先端側に前記爪が露出されてなる爪裏部を有しており、
前記ネイル装飾部の少なくとも一部を除去して、前記爪の表面側にジェルネイル剤を含むネイル施術を行うリペア工程と、
前記爪裏部の先端側を削る爪裏準備工程とを含み、
前記爪裏準備工程では、前記爪裏部に、前記ネイル装飾部が前記爪よりも先端側に伸びて積層する積層面を形成しており、
前記積層面に硬化した層を形成し、前記爪の表面側から裏面側にかけて硬化した層で被覆することを特徴とするネイル施術方法。

【請求項2】

請求項1に記載のネイル施術方法において、
前記爪の先端部側を除去して前記爪の長さを調整する長さ調整工程をさらに含み、
前記リペア工程は、前記長さ調整工程で調整された前記爪の先端部を覆うようにジェルネイル剤を塗布し、光照射により硬化させる工程を含むことを特徴とするネイル施術方法。

【請求項3】

請求項1に記載のネイル施術方法において、

前記爪裏準備工程の後、前記爪裏部にネイル施術を行って硬化した層で被覆された爪裏ネイル部を形成する爪裏施術工程をさらに含むことを特徴とするネイル施術方法。

【請求項 4】

請求項 3 に記載のネイル施術方法において、

前記爪裏施術工程では、前記爪裏部の少なくとも先端側に前記爪裏ネイル部を形成し、前記積層面を前記爪裏ネイル部により覆うことを特徴とするネイル施術方法。

【請求項 5】

請求項 3 または 4 に記載のネイル施術方法において、

前記爪裏施術工程では、前記爪裏ネイル部と前記指の先端部との間に、指の先端部よりも長く伸びた自身の爪である自爪が露出する露出部を設けることを特徴とするネイル施術方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ジェルネイル剤を用いたネイル施術方法に関する。

【背景技術】

【0002】

手や足の爪を装飾する手法として、マニキュアのほか、光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤を塗布して施術するジェルネイルも知られている。硬化したジェルネイル剤はマニキュア等のラッカーエナメルに比べて硬く、傷もつきにくい。そのため、ジェルネイルはその光沢や発色を長期間保つことができ、爪の保護にも役立ち、美しくなった爪に満足感を得られることから、広く好まれている。

【0003】

例えば特許文献 1 には、ジェルネイルの一般的な施術方法が開示されている。通常、爪の表面や爪先の形状を整えた後、ベースジェル、カラージェル、トップジェルの順に、塗布と光硬化とを繰り返す。また、前回のジェルネイルの施術から例えば数週間の経過後、新たなデザインのジェルネイルを施術する際には、前回のジェルネイルを爪の表面に残さないように完全に除去してから行うことが開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【文献】特開 2017-93966 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、前回のジェルネイルの施術から時間が経過するにつれて、爪の表面からはジェルネイルが剥がれやすくなり、爪とジェルネイルとの間に隙間ができることがある。ジェルネイルの明らかな剥がれだけでなく、目に見えない小さな隙間であったとしても、その部分には汚れや細菌等が入り込みやすくなってしまいう問題点がある。

【0006】

本発明は、このような実情にかんがみてなされたものであり、その目的とするところは、ジェルネイルの剥がれを抑制し得ること、ジェルネイルを施した爪の清潔さを保ち得ること、および手を使う作業を行いやすく継続的にジェルネイルを楽しみ得ることのうちの少なくとも 1 つを可能にする新たなネイル施術方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

前記の目的を達成するための本発明の解決手段は、光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤を用いるネイル施術方法であって、指の先端部よりも長く伸びた爪の表面にネイル施術されたネイル装飾部が設けられ、前記爪の裏面側は、前記指の先端部よりも先端側に前記爪が露出されてなる爪裏部を有しており、前記ネイル装飾部の少なくとも一部を除去し

10

20

30

40

50

て、前記爪の表面側にジェルネイル剤を含むネイル施術を行うリペア工程と、前記爪裏部の先端側の一部を除去する爪裏準備工程とを含み、前記爪裏準備工程では、前記爪裏部に、前記ネイル装飾部が前記爪よりも先端側に伸びて積層する積層面を形成しており、前記積層面に硬化した層を形成し、前記爪の表面側から裏面側にかけて硬化した層で被覆することを特徴としている。

【発明の効果】

【0008】

本発明によれば、ジェルネイルを施した爪の清潔さを保ちつつ継続的にジェルネイルを楽しむことを可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の実施形態に係るネイル施術方法を行う爪の一例を示す説明図である。

【図2】図1に示す爪の構成を模式的に示す断面図である。

【図3】前記ネイル施術方法における長さ調整工程を行った後の爪を模式的に示す断面図である。

【図4】図3に示す爪を指先側から見た説明図である。

【図5】前記ネイル施術方法における爪裏準備工程を示す説明図である。

【図6】前記爪裏準備工程での爪の構成を模式的に示す断面図である。

【図7】前記爪裏準備工程を行った後の爪を爪裏側から見て示す説明図である。

【図8】前記爪裏準備工程を行った後の爪の構成を模式的に示す断面図である。

【図9】前記ネイル施術方法における爪裏施術工程の一工程を爪裏側から見て示す説明図である。

【図10】図9の次工程を爪裏側から見て示す説明図である。

【図11】図10に示す爪の構成を模式的に示す断面図である。

【図12】図10の次工程を爪裏側から見て示す説明図である。

【図13】前記爪裏施術工程を行った後の爪の構成を模式的に示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

本発明の実施形態に係るネイル施術方法について、図面を参照しつつ説明する。

【0011】

図1は、本発明の実施形態に係るネイル施術方法を行う爪10の一例を示す説明図であり、図2は、図1に示す爪10の構成を模式的に示す断面図である。

【0012】

なお、以下の説明において、通常「爪」と呼ばれる部分である爪甲については自爪11と称し、ネイル施術を受ける人の自身の爪（爪甲）である自爪11と、その自爪11の表面にジェルネイル剤でネイル施術されているネイル装飾部12との両方を含めて爪10ということとする。

【0013】

本実施形態に係るネイル施術方法は、光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤を用いるものであり、既に自爪11の表面にネイル装飾部12が設けられている。そして、ネイル装飾部12のネイルデザインを変更したい場合や、自爪11が伸びてきた場合に、本実施形態に係るネイル施術方法を行う。

【0014】

図1に示すように、例えば、施術前の爪10は、その先端部101が指30の先端部（31）よりも長く伸びている。図2に示すように、爪10の裏面側は、指30の先端部31よりも先端側に、自爪11の裏面である爪裏部13が露出されている。自爪11の表面には、ジェルネイル剤を用いてネイル施術されたネイル装飾部12が設けられている。ネイル装飾部12が施術されてから時間経過したことにより自爪11が伸び、爪元102とネイル装飾部12との間に自爪11が一部露出している。

【0015】

なお、ネイル装飾部 12 は、図示するように、なだらかな山状の表面を有する形状であるに限らず、例えば種々の装飾パーツ等を用いたアートが施されて、立体的な凹凸形状を有していてもよい。

【0016】

（長さ調整工程）

本実施形態に係るネイル施術方法は、爪 10 の長さを調整する長さ調整工程を含む。図 2 に示すように、例えば長さ調整ライン A に示される長さとなるように、爪 10 の少なくとも一部を除去して、爪 10 の長さを調整する。長さ調整は、ファイルまたはエメリーボードと呼ばれる専用のヤスリ等の調整用具を用いて、爪 10 の長さおよび形状を整えることにより行う。

10

【0017】

この場合、ネイル装飾部 12 が設けられている爪 10 の先端側に、調整用具をあてがい、自爪 11 およびネイル装飾部 12 をともに削り取って、指 30 の長さ方向に交差する長さ調整ライン A に沿うように除去する。

【0018】

図 3 は、本実施形態に係るネイル施術方法の長さ調整工程後の爪 10 を模式的に示す断面図であり、図 4 は、図 3 に示す爪 10 を指先側から見た説明図である。図示するように、長さ調整工程で、ネイル装飾部 12 と自爪 11 とをともに除去したことで、図 1 に示した爪 10 の先端部 101 が除去され、図 3 および図 4 に示すように、ネイル装飾部 12 と自爪 11 とが積層されて見える積層端面 14 が形成される。

20

【0019】

（リペア工程）

次いで、自爪 11 の表面に設けられているネイル装飾部 12 の少なくとも一部を除去して、爪 10 の表面側にジェルネイル剤を含むネイル施術を行う（リペア工程）。ネイル装飾部 12 は、通常、光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤であってクリアジェルとも呼ばれるベースジェルを用いたベース層の上に、ジェルネイルのデザインの主要部分となるカラー層を形成し、そのカラー層の上にクリアジェル（トップジェルともいう）を塗布して硬化させたトップコート層を設けて、形成されている。

【0020】

リペア工程では、このようなネイル装飾部 12 のベース層の大部分を自爪 11 の上に残し、カラー層とトップコート層とを除去することで、新たなデザインのネイル装飾部 12 を形成する。これらの層の除去は、ネイルマシンと呼ばれる種々の切削器やエメリーボード等を用いて行う。なお、トップコート層はベース層と同様のクリアジェルからなるので、自爪 11 に残してもよい。ベース層を自爪 11 に残すことで、自爪 11 と切削器が接触したり自爪 11 が薄くなったりするおそれがなく、自爪 11 を傷めることなくデザインを変更することが可能となる。

30

【0021】

また、リペア工程は、長さ調整工程で形成した積層端面 14 を覆うようにジェルネイル剤を塗布し、専用の UV ライトまたは LED ライトを用いて特定波長の光を照射してジェルネイル剤を硬化させる工程を含む。ジェルネイル剤は、クリアジェル、またはカラージェルのいずれであってもよく、両方であってもよい。積層端面 14 がジェルネイル剤で覆われ、光硬化されることで、積層端面 14 を保護することができ、自爪 11 とネイル装飾部 12 との間に隙間ができたり、自爪 11 からネイル装飾部 12 が剥がれたりすることを防ぐことができる。そのため、爪 10 の先端側に汚れが付着しにくくなり、指先を清潔に保つことが可能となる。

40

【0022】

なお、ジェルネイル剤には硬さの異なるハードジェルとソフトジェルとがあるが、本発明方法では光硬化性樹脂を含有するジェルネイル剤であれば、どのようなジェルネイル剤を用いてもよい。爪 10 の長さをだすために、ネイルチップ等の人工爪を装着した状態であってもよく、その場合にあっては装着された人工爪を含めて自爪 11 として上記の施術

50

を行うことができる。また、本発明方法は、手指の爪 10 だけではなく、足指の爪に対しても同様に施術可能であることは言うまでもない。

【0023】

（爪裏準備工程）

図 5 は、本実施形態に係るネイル施術方法における爪裏準備工程を示す説明図、図 6 は、爪裏準備工程での爪 10 を模式的に示す断面図、図 7 は、爪裏準備工程を行った後の爪 10 を爪裏側から見て示す説明図、図 8 は、爪裏準備工程を行った後の爪 10 を模式的に示す断面図である。

【0024】

例示の形態に係るネイル施術方法では、リペア工程に続けて、爪裏部 13 の先端側を削る爪裏準備工程を行う。この爪裏準備工程では、図 6 に例示するように、指 30 の長さ方向とほぼ平行となる裏削りライン B に沿うように爪裏部 13 を除去する。

【0025】

爪裏準備工程では、まず、ネイルマシンと呼ばれる種々の切削器を爪 10 の先端部 101 の爪裏（爪裏部 13）にあてがって爪裏部 13 の一部を削る。次いで、図 5 に示すように、ファイルまたはエメリーボードと呼ばれる専用のヤスリ等の裏削り具 40 を、爪裏部 13 側にあてがって、裏削りライン B に沿うように爪裏部 13 の一部を削り取る。このとき、ネイルマシンによって爪裏部 13 の面に生じた段差が滑らかになるように、裏削り具 40 を爪裏部 13 の真下にあてがって削ることが好ましい。

【0026】

これにより、図 7 および図 8 に示すように、爪 10 を指の腹側から見た時に、自爪 11 よりもネイル装飾部 12 が先端側に伸びて見え、自爪 11 とネイル装飾部 12 とが積層している積層面 15 を形成する。爪裏準備工程は、次に行う爪裏施術工程の準備工程とすることができ、施術面としての積層面 15 を設けることができる。

【0027】

このような爪裏準備工程は、長さ調整工程よりも後に行うことが好ましい。また、爪裏準備工程は、リペア工程の後に行うことが好ましい。ただし、このような爪裏準備工程を、リペア工程と並行して、またはリペア工程の途中で行ってもよい。

【0028】

（爪裏施術工程）

図 9～図 13 は、本実施形態に係るネイル施術方法の爪裏施術工程を示し、図 9 は、爪裏施術工程の一工程を爪裏側から見て示す説明図、図 10 は、図 9 の次工程を爪裏側から見て示す説明図、図 11 は、図 10 に示す爪裏部 13 を模式的に示す断面図、図 12 は、図 10 の次工程を爪裏側から見て示す説明図、図 13 は、爪裏施術工程を終えた爪 10 を模式的に示す断面図である。

【0029】

本実施形態に係るネイル施術方法では、爪裏準備工程の後、爪裏部 13 にネイル施術を行って爪裏ネイル部 20 を形成する（爪裏施術工程）。

【0030】

図 9 に示すように、爪裏部 13 の少なくとも先端側に、ネイルグルー 211 をブラシ 50 で塗布し、アクティベーターを用いて硬化させる。ブラシ 50 にはネイルグルー 211 の容器に付帯されているブラシを用いることができる。

【0031】

このとき、ネイルグルー 211 を、爪裏部 13 の先端側の積層面 15 の全体を覆うように塗布する。また、指 30 の先端部 31 にはネイルグルー 211 が付着しないようにし、指 30 の先端部 31 寄りから爪裏部 13 の先端部方向に向かって塗布し、自爪 11 が露出する部分を残すようにする。

【0032】

ネイルグルー 211 には、ネイルチップ（人工爪または付け爪）を自爪に接着する際に利用される、一般的にネイルグルーと称される透明色の接着剤を使用することができる。

10

20

30

40

50

また、ネイルグルー２１１とともに、硬化時間を短縮するためにアクティベーター（硬化促進剤）を、ネイルグルー２１１に噴霧する。アクティベーターは、ミストタイプのものが好ましい。アクティベーターを併用することでネイルグルー２１１の発熱を抑えることができるとともに、ネイルグルー２１１を短時間で硬化させることができる。

【００３３】

ネイルグルー２１１には、例えば、２－シアノアクリル酸エチル、ポリメチルメタアクリレート、およびヒドロキノンを含む透明色のジェル状接着剤を好適に用いることができる。ネイルグルー２１１の具体例としては、「ネイルアートグルー（NAG-1）、ビューティーネイラー社製」等が挙げられ、アクティベーターの具体例としては、「NFS・NEOジェルアクチベーター、TAT社製」等が挙げられる。

10

【００３４】

爪裏部１３には、ネイルグルー２１１が硬化することで透明色のクリア層２１が形成される。これにより、図１０および図１１に示すように、爪裏準備工程によって爪裏部１３に形成されていた積層面１５を被覆するように、クリア層２１からなる爪裏ネイル部２０を形成できる。指３０の先端部３１にはネイルグルー２１１が付着しないように施術したことにより、この爪裏ネイル部２０と、指３０の先端部３１との間は、わずかに間隔が設けられており、自爪１１の裏面が露出した状態の露出部（非施術部）Ｇが設けられる。

【００３５】

なお、ネイルグルー２１１は透明色のジェル状接着剤であれば前記のものに限られず、またアクティベーターにあってもネイルグルー２１１の硬化を促進させるものであれば前記のものに限定されない。

20

【００３６】

また、爪裏施術工程においてはネイルグルー２１１等を用いるに限られず、爪裏部１３にジェルネイル剤を塗布し、光照射により硬化させて爪裏ネイル部２０を形成してもよい。例えば、爪裏部１３の積層面１５を覆い、かつ指３０の先端部３１に付着させないようにクリアジェルをブラシ５０で塗布し、光硬化させて、クリア層２１および非施術部Ｇを形成してもよい。クリアジェルは、光硬化性樹脂を含む透明色のジェルネイル剤であり、硬化させることで透明色のクリア層２１を形成することができる。また、クリア層２１にかえて、ジェルネイル剤としてカラージェル、または粉体もしくは微小片を含む混合ジェルを塗布し、光照射により硬化させて、爪裏ネイル部２０としてのカラー層を形成してもよい。

30

【００３７】

さらに、図１２および図１３に示すように、爪裏ネイル部２０として、クリア層２１を重ねてカラー層２２を設けてもよい。すなわち、爪裏施術工程では、ジェルネイル剤として透明色のクリアジェルを塗布し、光照射により硬化させて爪裏ネイル部２０のクリア層２１を形成する工程と、ジェルネイル剤としてカラージェル、または粉体もしくは微小片を含む混合ジェルを塗布し、光照射により硬化させて、爪裏ネイル部２０のカラー層２２を形成する工程とを行ってもよい。カラー層２２を形成する際にも、カラー層２２（爪裏ネイル部２０）と、指３０の先端部３１との間にはわずかに間隔を設けて、自爪１１が露出している露出部Ｇを設ける。

40

【００３８】

爪裏部１３に爪裏ネイル部２０を形成することで、指３０の先端部３１よりも長く伸びた爪裏部１３を美しく見せ、爪裏部１３を保護しつつ清潔に保つことが可能となる。爪裏ネイル部２０と指３０の先端部３１の間には露出部Ｇがあるので、施術中だけでなく施術後においても指３０に負担がかからず、長期間にわたり快適にジェルネイルを楽しむことができる。

【００３９】

なお、爪裏施術工程としては、クリア層２１だけを形成してもよいし、カラー層２２だけを形成してもよい。したがって、クリア層２１かカラー層２２のいずれか一層からなる単層構造とされても、爪裏ネイル部２０はクリア層２１とカラー層２２を含む複層構造と

50

されてもよい。

【0040】

以上のように施術することで、爪10の先端部101の積層端面14も、爪裏部13の積層面15も、ともに硬化した層で被覆されて一体化されるので、自爪11からネイル装飾部12が剥がれにくくなり、自爪11とネイル装飾部12との間に隙間が形成されるのを防ぐことができる。そのため、汚れが入り込む部分が発生しにくくなり、長期間にわたってネイル施術した爪10の清潔さを保つことが可能となる。その結果、爪10を衛生的に育成しつつ、継続的にジェルネイルを楽しむことが可能となる。

【0041】

また、爪裏部13は爪裏施術工程の前に爪裏準備工程によって積層面15が設けられて、爪10の先端側ほど厚みが薄くなっている。そのため、長さを有する爪10であっても手を使う作業を行いやすくなり、美しくなった爪10とともに快適に日常生活を送ることができる。

10

【0042】

なお、本発明の技術的範囲は、前記実施の形態のみによって解釈されるものではなく、特許請求の範囲に基づくものとされる。また、本発明の技術的範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。

【産業上の利用可能性】

【0043】

本発明は、爪を装飾するジェルネイルの施術方法として好適に利用可能である。

20

【符号の説明】

【0044】

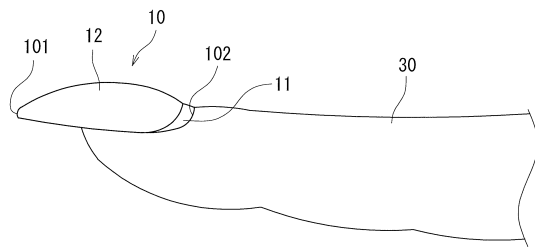
- 10 爪
- 101 先端部
- 102 爪元
- 11 自爪
- 12 ネイル装飾部
- 13 爪裏部
- 14 積層端面
- 15 積層面
- 20 爪裏ネイル部
- 21 クリア層
- 211 ネイルグルー
- 22 カラー層
- 30 指
- 31 先端部
- 40 裏削り具
- 50 ブラシ
- A 長さ調整ライン
- B 裏削りライン
- G 露出部（非施術部）

30

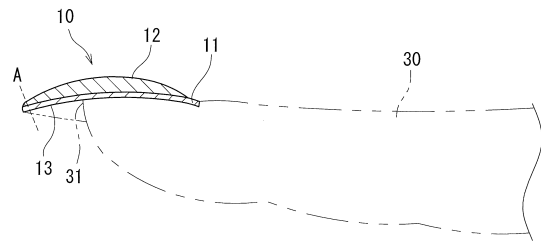
40

【図面】

【図 1】

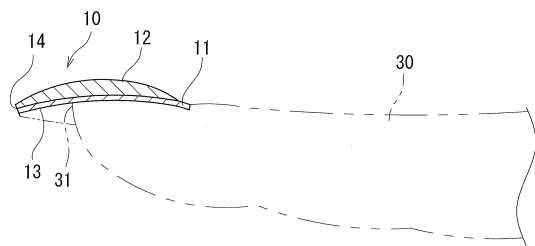


【図 2】

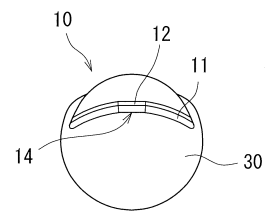


10

【図 3】



【図 4】



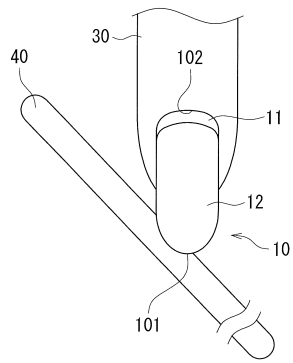
20

30

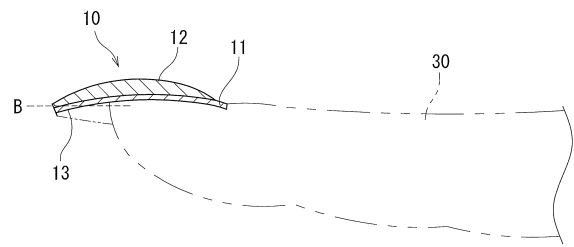
40

50

【図 5】

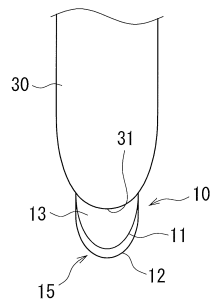


【図 6】

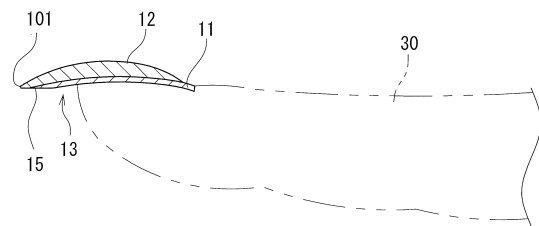


10

【図 7】



【図 8】



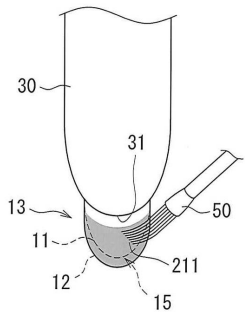
20

30

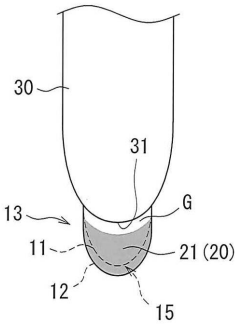
40

50

【図 9】

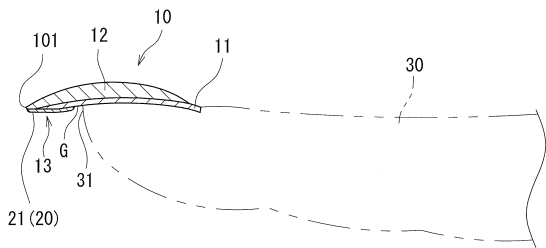


【図 10】

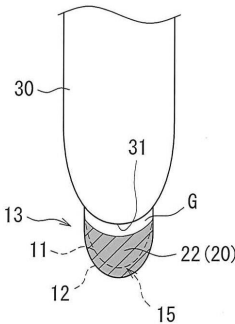


10

【図 11】



【図 12】



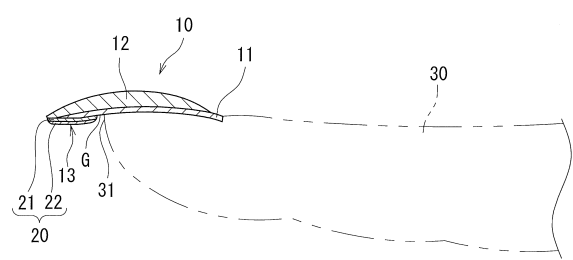
20

30

40

50

【図 13】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 国際公開第2017/122571 (WO, A1)
 国際公開第2015/152210 (WO, A1)
 特開2013-075859 (JP, A)
 特開2015-000873 (JP, A)
 特開2017-093966 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
 A45D 29/00~29/22